

تبديل مستقيمه انرژی III

پیل خورشیدی (مبدل فیوولتایی)

Photovoltaic Energy Converion
Solar Cells

نوشته :

تقی ابتکار Ph.D.

دانشکده فنی

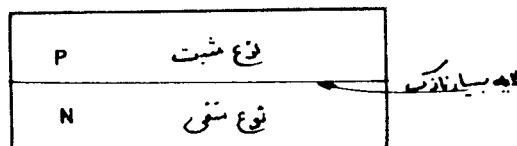
۱- مقدمه و معرفی

در مطالعه مبدل ترموالکتریک (صفحه ۴۸، مجله دانشکده فنی شماره ۳، مشاهده گردید که برای رسیدن به حداکثر ضریب تیخسین لازم است که از نیمه رساناها جهت ساختمان مبدل استفاده شود در آن بخش ملاحظه شد که چگونه جریان حرارت بتوسط اتصالات نیمه رساناها میتوان متناسب مستقیماً بجریان الکتریسیته مورد نظر تبدیل میشود. همچنین ملاحظه گردید که مزیت اصلی نیمه رساناها در این مورد اینست که سطوح طراز فیرمی Fermi Level در آنها در اثر حرارت تغییر فاصلی میباشد و همچنین باعث بالا رفتن ضریب سیبک (Seebeck) میگردد.

بطریق دیگر نیز میتوان از نیمه رساناها جهت تولید قدرت الکتریک استفاده نمود. طریق مورد نظر دیگر یک ماشین حرارتی نیست بلکه عبارتست از یک وسیله مکانیکی کوانتیک. این وسیله موسوم است به مؤلد فتوولتائی که ذیلاً معرفی میگردد.

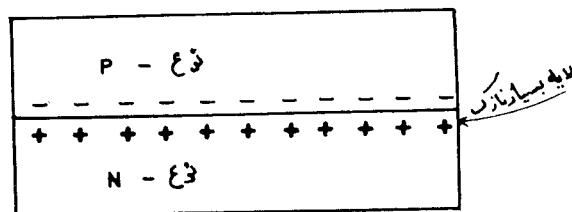
یک کریستال از جسم نیمه رسانا را انتخاب نموده و غشائی در اطراف آن تولید مینماییم بطوریکه در یکطرف آن فقط نوع کریستال منفی وجود داشته باشد (N-type) و طرف دیگر آن مطابق شکل ا نوع مشبّت (P-type) و فرض میکنیم که تغییر از حالت N به حالت P در یک لایه بسیار نازک صورت بگیردو باستثنای این لایه در سایر قسمتهای کریستال وضع کاملاً یکنواخت وجود داشته باشد.

در مقایسه با نوع P چون نوع N دارای مقدار زیادتری الکترون آزاد است الکترونها از نوع N به نوع P نفوذ نمینمایند - و حفره‌ها (که محل خالی الکترونها است) در جهت عکس حرکت می‌کنند. از طرفی چون اتصال N - P مزبور از نظر الکتریکی خنثی است بنابراین الکترونها ایکه منطقه N را ترک نمی‌کنند سطح متصل به منطقه P را دارای یک بار مثبت نمینمایند و معکوس آنها در مورد منطقه P و سطح روی منطقه P دارای بار منفی می‌شود (مطابق شکل ۲).



(شکل ۱)

حال فرض کنیم که این قطعه در برابر اشعه نورانی با فرکانس معلوم قرار گیرد. بمحض پدیده فتوالکتریک اگر انرژی ذرات نورانی مزبور از تابع کار مربوط به سطح این قطعه بیشتر باشد باعث آزادشدن الکtron از سطح می‌شود.



(شکل ۲)

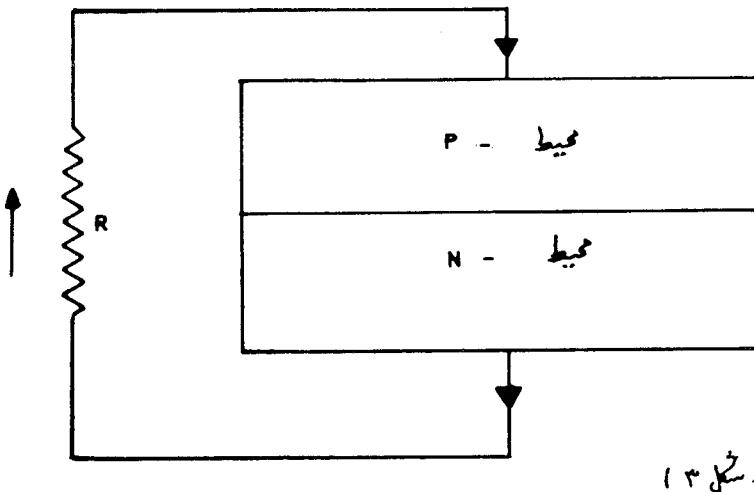
توضیح اینکه الکترونها مربوط قطعه مورد بحث بحالات آزاد نیستند که بدون مانع پس از برخورد فوتوهای نورانی جابجا شوند بلکه مقداری انرژی هم باید صرف باصطلاح کنند آنها از سطح شود و این بخوبی بواسطه رابطه مشهور فتوالکتریک پیشنهادی البzt آنیشتین معلوم می‌شود :

$$(E = hv - \Phi)$$

hv انرژی اشعه نورانی است که در آن h ثابت پلانک و v فرکانس نور است و Φ همان تابع کار است که بحساب انرژی نورانی باید گذاشته شود تا انرژی الکtron آزاد شده بدلست آید.

پس از این توضیح ملاحظه می‌شود که در اتصال N - P مورد بحث اگر فوتونهای امواج نورانی دارای انرژی کافی باشند پس از برخورد با سطح باعث می‌شوند که یک الکtron پس از جدا شدن از محیط منوعه انرژی نیر عبور کرده و در نتیجه تولید یک و زوج حفره - الکtron بنمایند. اگر کریستال مورد بحث خالص باشد این زوج در داخل کریستال حرکت می‌کنند تا هنگامیکه تجمع مجدد صورت گرفته و این زوج منحدم شوند.

اما اگر قطعه N-P مطابق آنچه گذشت جسم خالص نباشد و زوج حفره - انکترون تولید شده بطرف محل اتصال N-P حرکت کند - در این حال الکترونها جذب بار مشبت موجود در لایه N میشود و حفره وضع معکوس را پیدا میکند. باین ترتیب قرار گرفتن الکترون و حفره در اتصال N-P باعث بهم خورد تعادل این لایه ها میشود و در این وضع کریستال متمایل میشود که تعادل مجددی برقرار کند یک رامجهت امکان پیدایش این تعادل این است که توسط یک مقاومت خارجی مطابق شکل ۳ سطوح کریستال P و N را مهم مربوط کنند.



(شکل ۱۳)

اگر مقاومت R در مدار قرار گیرد الکترون موجود در محیط N از مدار و مقاومت R گذشته و بطرف محیط P رفته در آنجا با حفره تولید شده اولیه جمع میشود. باین ترتیب در اثر تابش نور مقدار زیادی الکترون مرتبآ از محیط N توسط بار R به محیط P رفته در آنجا توسط حفره ها خنثی میشوند و عمل ادامه یافته. و تولید الکتریسیته میشود.

۲- محاسبات پیل خورشیدی

در مقدمه مشاهده گردید که اتصال N-P از دو قسمت تشکیل میشود که جنس آنها از آلیاژهای نیمه رسانا است و از طرفی میدانیم که اتصال دو نیمه رسانا هم زمان است با یکسان شدن سطح طراز فرسی (Fermi Level) در سراسر آنها دیاگرام انرژی ترکیبی مانند شکل ۴ خواهد بود.

الکترونها هنگام عبور از N بطرف P باید دیواره اختلاف پتانسیل اتصال V_0 را طی کنند انرژی مربوطه عبارتست از eV_0 . حالا ملاحظه میشود که اگر طرز توزیع الکترونها یکی که لازمست از این دیواره عبور کنند بشکل توزیع ماسکول باشد.

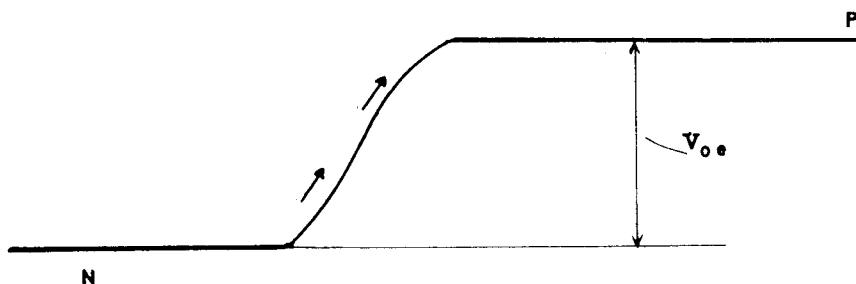
$$\text{یعنی } \left(e^{-\frac{\epsilon}{KT}} \right)^{\infty} \text{، کسری از الکترونها که میتوانند از این دیواره عبور کنند عبارتست از } e^{\frac{-eV_0}{KT}}$$

بنابراین اگر n_0 دانسیته الکترونها باشد در قسمت N جریان عبوری از نیمه رسانای N بطرف

نیمه‌رسانای P از عمل اتصال عبارت می‌شود از :

$$[1] \quad J_{n \rightarrow p} = C n_n e^{-\frac{eV_0}{kT}}$$

C عدد ثابتی است و T درجه حرارت مطلق و K ثابت بولتزمن است) بر عکس الکترونهای بکه مسیری از P



(شکر ۴)

بطرف N دارند در مقابل دیواره ندارند و در واقع برخلاف حالت بالا که مطابق شکل ۴ لازم بود (سربالائی) را طی کنند در این حال در مسیر (سرپائینی) قرار دارند پس :

$$[2] \quad J_{p \rightarrow n} = C n_p$$

n_p عبارتست از دانسیته الکترونهای در قسمت یکنواخت نیمه‌رسانای P. توجه می‌نماییم که در این تحلیل لایه تبادلات با مقایسه با مسیر متوسط الکترونی بسیار نازک فرض شده است.

در حالت تعادل مسلمًا الکترون اضافی تولید نمی‌شود و بنابراین از معادلات (۱) و (۲) :

$$[3] \quad J_{n \rightarrow p} = J_{p \rightarrow n} \equiv J_{eo}$$

و اینکه :

$$C n_n e^{-\frac{eV_e}{kT}} = C n_p$$

و یا :

$$[4] \quad n_p = n_n e^{-\frac{(eV_0)}{kT}}$$

معادله (۴) یک حالت تعادل را بین الکترونهای نیمه‌رسانای P والکترونهای نیمه‌رسانای N مینماید همین الکترونهای n_p بر واحد حجم نیمه‌رسانای P بوجود آورنده پدیده فتوولتائی است و به کاربر اقلیت مشهور می‌باشد (Minority Carriers) حالا فرض کنیم بدلیل اختلاف پتانسیل دیواره V با اندازه V_0 پائین آورده شود ارتفاع دیواره که الکترون باید بگذرد در این وضع $V - V_0$ است.

معادله [۱] بفرم زیر در می‌آید :

$$[5] \quad J_{n \rightarrow p} = C n_n e^{-\frac{e(V_0 - V)}{kT}}$$

و مانند قبل $J_{p \rightarrow n} = C n_p e^{-\frac{e(V_0 - V)}{kT}}$ چون ارتفاع دیواره تأثیری روی جریان معکوس ندارد. جریان خالص گذرنده از اتصال میشود :

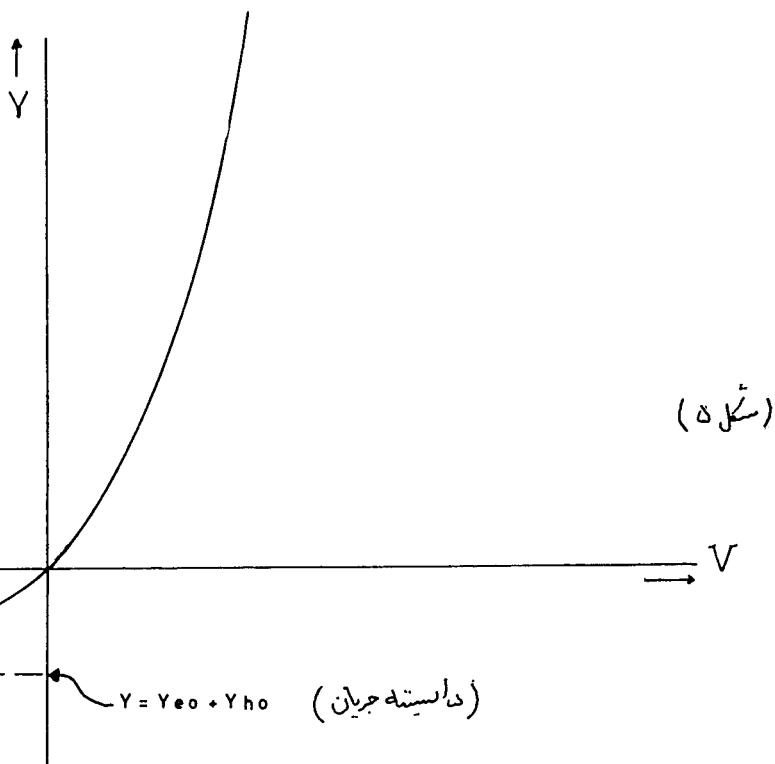
$$[6] \quad J_e = J_{n \rightarrow p} - J_{p \rightarrow n} = J_{eo} \left[e^{\frac{eV}{kT}} - 1 \right]$$

عیناً مانند آنچه در مورد اثبات رابطه [۶] بیان شد میتوان بسهولت رابطه در مورد حفره ها پیدا کرد. جریان مربوطه میشود :

$$[7] \quad J_h = J_{ho} \left[e^{\frac{eV}{kT}} - 1 \right]$$

J_{eo} را در معادله [۳] تعریف کردیم J_{eo} نیز متشابه با قابل بیان است. جریان کلی که از اتصال عبور میکند مجموع جریان الکترونهای و جریان حفره ها است یعنی :

$$[8] \quad J = J_e + J_n = (J_{eo} + J_{no}) \left[e^{\frac{eV}{kT}} - 1 \right]$$

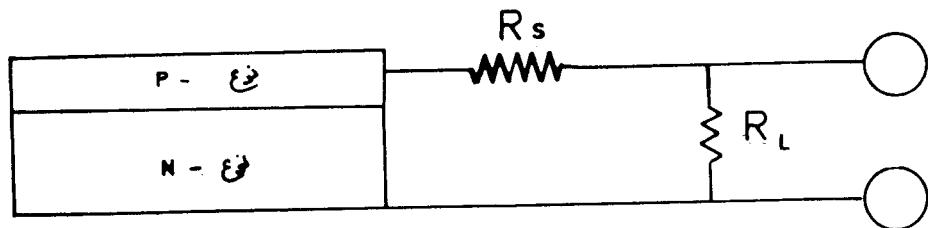


توضیح : در شکل ه بجای کلیه حروف Y باستی حروف J خوانده شود .

از این معادله بخوبی پیداست که جریان کلی قویاً تابع ولتاژ V است - نمایش تغییرات J و V در شکل (۶) ترسیم شده است.

از این شکل بخوبی پیداست که دستگاه نظیر یک نوع یکسو-کننده کار میکند.

اگر V مشبک باشد نتیجه عمل دستگاه تولید مقدار زیادی جریان J است و بر عکس اگر V منفی باشد (جریان معکوس) دستگاه تولید مقدار کمی جریان میکند این پدیده در مطالعه ترانزیستورها اهمیت فراوان دارد اینکه میپردازیم به توجیه ولتاژ پائین آورده شده V در همین مبحث پدیده قتوولتاوی نیز توجیه میشود شکل ۶ را مورد توجه قرار میدهیم.



(شکل ۶)

در این شکل یک لایه نازک نوع P به یک لایه نوع N متصل شده و این دو لایه ساندویچ شکل بتوسط بار الکتریکی R_L بهم متصلتند مقاومت سری R_S نیز از جهت مقاومت لایه نازک نوع $-P$ اضافه شده است تا در مسیر جریان قرار گیرد.

حال مطابق آنچه در قسمت قبل ذکر شد فرض میکنیم دوازه برخورد اشعه نورانی به لایه ساندویچ شکل مزبور یک زوج الکترون و حفره در همسایگی محل اتصال دو نیمه رسانای P و N بوجود آید و این زوج بداخل محل اتصال نفوذ کنند (یعنی در محلی که بارهای مشبک و منفی جدا شده اند). کاربر اقلیت که مولد جریان برق هستند آزادانه از محل اتصال عبور میکنند در این تحلیل جریان برق مورد نظر مزبور را به I نشان میدهیم.

حال فرض کنیم هیچگونه بار الکتریکی خارجی بین P و N نباشد چون مقدار خالص جریان در این حال صفر است بنابراین لازمه است که یک اختلاف پتانسیل V در سراسر منطقه اتصال بوجود تا بتوسط آن دو جریان مساوی با علامات مختلف بطرف جلو (جریان اصلی) رانده شود. این جریان بطرف جلو درست برابر است یا جریانی که تولید میشود اگر اختلاف پتانسیل V مطابق آنچه قبله گفته شد در دو طرف اتصال P و N گذاشته شود معادله (۸) اگر برای جریانها ابجای دانسیته جریان نوشته عبارتست از:

$$I_j = I_s = I_o \left[e^{\frac{eV}{R \cdot T}} - 1 \right] \quad [۶]$$

که در این معادله پارامیرهای مختلف عبارتند از:

I_j — جریان اصلی مدار.

I_s — مقدار کل کاربر اقلیت در منطقه اتصال (جریان معکوس).

V — ولتاژ تولیدی در منطقه محل اتصال درجهت قدامی.

I_0 — جریان سیر شده مدار درجهت معکوس (در غیاب اختلاف پتانسیل).

چون مطابق آنچه گذشت دستگاه مولد فتوولتائی بصورت یک مولد مدار باز است مقدار اختلاف

پتانسیل V در معادله (۹) عبارتست از حداکثر ولتاژ ممکن اگر معادله (۹) را جهت تعیین V حل کنیم

خواهیم داشت:

$$[10] \quad V_{max} = \frac{KT}{e} I_n \left[\frac{I_s}{I_j} + 1 \right]$$

حال اگر یک بار الکتریکی در دو طرف مدار مولد فتوولتائی قرار گیرد (مطابق شکل ۶) در مدار یک جریان الکتریکی برقرار میشود.

اختلاف پتانسیل قابل سنجش در این حال ممکن است از V_{max} کوچکتر باشد. زیرا در این مرحله

جریان اصلی مدار کمتر خواهد بود. جریانی که از مقاومت خارجی عبور میکند عبارتست از جریان معکوس

که هنوز برابر مقدار نظیر درحال مدار باز است و جریان اصلی مدار که از حالت بی بار کمتر است یعنی اگر

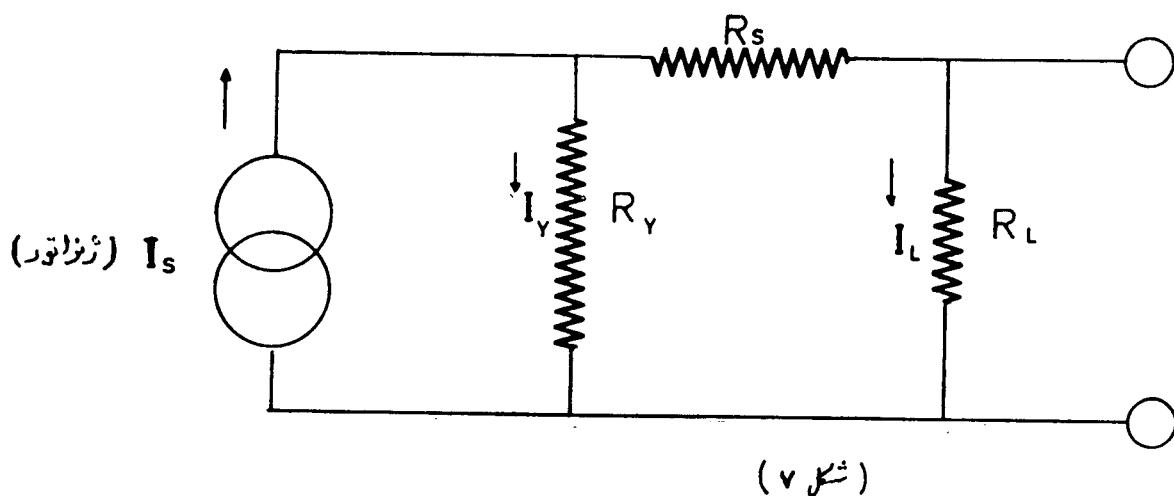
I_L جریانی باشد که از R_L عبور میکند:

$$I_L = I_s - I_j$$

و با بکار بردن معادله (۹) :

$$[11] \quad I_L = I_s - I_0 \left[e^{\frac{eV}{KT}} - 1 \right]$$

مدار الکتریکی شکل ۶ مطابق شکل (۷) پیش بینی میشود.



توضیح: در شکل ۷ اندیمای Y بایستی J خوانده شود.

برای بررسی بیشتری در باره ژنراتور فتوولتائی این بحث را قدری بیشتری ادامه میدهیم و جهت سهولت محاسبات فرض میکنیم در مدار شکل (۷) مقاومت $R_S = 0$ باشد و در این حال در جستجوی وضعی بر می آییم که باطری خورشیدی حداکثر قدرت تولیدی را ایجاد میکند.

مقدمتتاً ملاحظه میشود که مطابق مدار شکل شماره (۷) قدرت تولیدی حداکثر است اگر $R_L = R_J$ باشد از طرفی مقاومت اتصال لایه های مولد فتوولتائی بشکل خیلی زیادی غیر خطی است برای یک وضع کار ژنراتور R_J را میتوان بکمک معادله (۹) محاسبه گردد:

$$[12] \quad R_J = \frac{V_J}{I_J} = \frac{KT}{eI_o} e^{-\frac{eV}{KT}}$$

یعنی برای حداکثر قدرت:

$$[13] \quad R_L = R_J = \frac{e}{\frac{eV_{mp}}{KT}}$$

در حالیکه V_{mp} عبارتست از افت تانسیون اتصال برای حداکثر قدرت تولیدی از آنجا شدت جریان عبوری از مدار خارجی نظیر حداکثر قدرت عبارت است از:

$$[14] \quad I_{mp} = \frac{V_{mp}}{R_{L,mp}}$$

اگر معادلات ۱۳ و ۱۴ در معادله ۱۱ گذارده شود داریم:

$$[15] \quad e^{\lambda V_{mp}} (1 + \lambda V_{mp}) = \frac{I_s}{I_o} + 1$$

که در آن:

$$\lambda = \frac{e}{KT}$$

حال بکمک معادلات (۱۱) و (۱۵) میتوان I_{mp} را حساب کرد:

$$[16] \quad I_{mp} = \left(\frac{\lambda V_{mp}}{1 + \lambda V_{mp}} \right) (I_s + I_o)$$

در پیلهای خورشیدی I_s در حدود ۱۰۰ آمپر برای هرسانتیمتر مربع است در حالیکه اندازه I_o در پیلهای خورشیدی به حدود میکروآمپر برای هرسانتیمتر مربع محدود میشود.

از طرفی عملاً در پیلهای خورشیدی $\lambda V_{mp} > 10$ میباشد بنابراین بموجب معادله (۱۶) :

$$[17] \quad I_{mp} \approx I_s$$

از طرف دیگر اگر معادله (۱) را بفرم زیر بنویسیم :

$$\frac{I_s + 1}{I_s} = e^{\frac{eV_{max}}{KT}} = e^{\lambda V_{max}}$$

و آنرا با معادله (۵) مقایسه کنیم با توجه بینکه عملاً در پیلهای خورشیدی $10 > \lambda V_{mp}$ میباشد با تقریب کافی نتیجه میشود که فرق زیادی بین V_{max} و V_{mp} نمیتواند وجود داشته باشد.

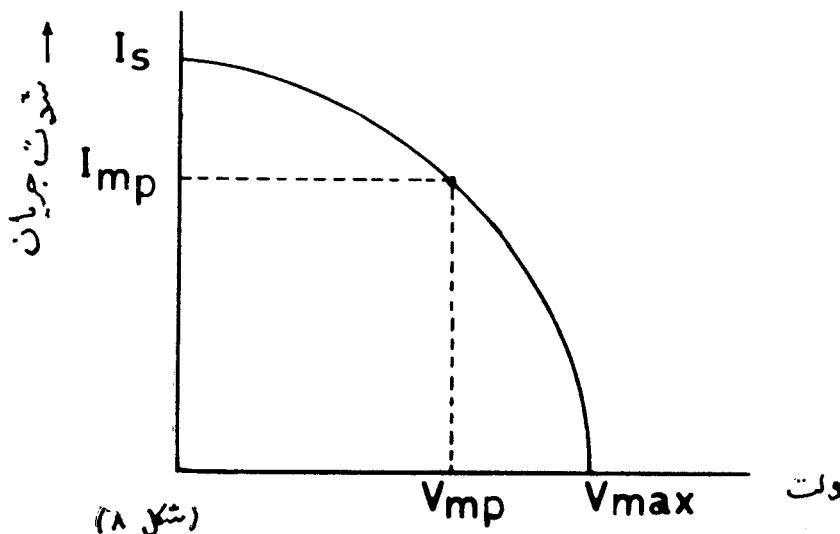
از مقایسه این نتیجه و معادله (۷) این مطلب مهم عاید میشود که بعلمت مشخصه اصلی پیل فتوولتائی فرق زیادی بین پارامترهای نشان دهنده حداکثر قدرت (V_{mp} و I_{mp}) و حداکثر پارامترهای مزبور (V_{max} و I_{max}) وجود ندارد.

و این برای پیل خورشیدی بعنوان یک منبع تولید مستقیم انرژی یک مزیت بسیار زیادی است. اگر دو طرف رابطه (۶) را در V_{mp} ضرب کنیم حداکثر قدرت تولیدی پیل خورشیدی بدست

می آید :

$$[18] \quad P_{max} = \left(\frac{\lambda V_{mp}}{1 + \lambda V_{mp}} \right) \left(\frac{I_s}{I_s + 1} \right) I_s V_{mp}$$

از آنچه قبل گفته شد مشاهده میشود که حاصلضرب پرانژهای طرف راست معادله نزدیک بواسطه واحد است و حاصلضرب I_s در V_{mp} مقدار حداکثر قدرت تولیدی پیل خورشیدی را نشان میدهد. نمایش تغییرات شدت جریان و اختلاف پتانسیل برای یک پیل خورشیدی مطابق شکل (۸) است.



۳- موارد کاربرد پیل خورشیدی

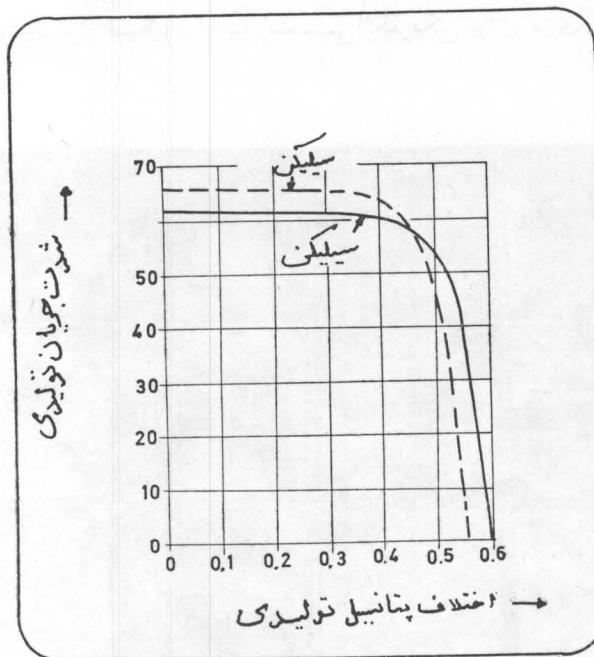
مولد پیل خورشیدی یکی از مبدلها میهم تبدیل مستقیم انرژی است ساختمان آن نسبتاً آسان است

است و معروف است که اگر سطح ایالت آریزونای آمریکا بوسیله سطوح این مبدلها پوشیده شود قدرت تولید شده پاندازه است که میتواند جوابگوی مصرف آمریکا باشد. در کشور ما با وجود آفتاب فراوانی که وجود دارد بعثت منابع سرشار خدا داد نفت و گازهای طبیعی این نوع وسائل تولید انرژی فعلاً مقرر بصره نیست ولی همواره باید درنظر داشت که اشعه آفتاب تنها منبع انرژی است که تمام شدنی نیست بنابر همین ایده است که پیل خورشیدی بعنوان منبع تولید انرژی در آینده اهمیت زیادی دارد در کارهای فضائی پیل خورشیدی منبع مهم تولید قدرت است و در زیره وسائلی است که فضانوردان در سطح ماه قرار داده اند و وسیله و محرك اصلی لونا خود کشور سوری پیلهای آفتابی است.

در سالهای اول برنامه های فضائی (۱۹۵۷-۶۰) پیلهای طرح شده در حدود یک کیلووات تولید قدرت مینمودند در سال ۱۹۶۵ ناسا برای مصرف پروژه آپولو طرح یک پیل خورشیدی ۵ کیلوواتی را پیشنهاد نموده بعداً برای مسافرت های بین کرات پیلی مورد بررسی قرار گرفت که تا ۵ کیلووات قدرت داشت وزن آن برای تولید هر کیلووات به ۰.۰ پوند محدود می شود در طرح های جدید توانسته از هرفوت مریع تا ۱.۱ وات قدرت استخراج نمایند.

در چند کلیشه که خاتمتاً ضمیمه می شود مشخصات عملی پیل خورشیدی بیان می گردد.

در شکل ۹ تغییرات شدت جریان و اختلاف پتانسیل برای پیلهای N روی P و پیلهای P روی N نشان داده شده اختلاف بین منحنی های نمایش تغییرات جالب توجه می باشد (شکل ۹).

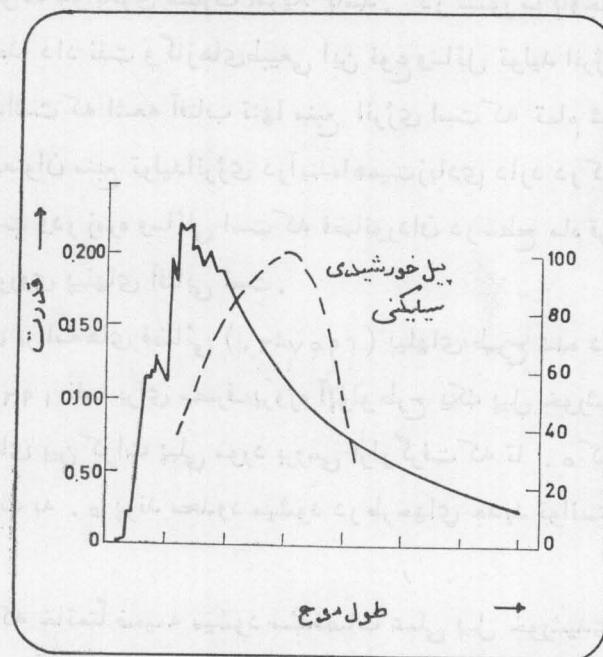


(شکل ۹)

در ساختمان پیلهای اول از نفوذ فسفر در میلیکن (تیپ - P) استفاده شده.

شکل شماره ۱۰ نشان میدهد که چگونه یک قطعه ساندویچ شکل پیل خورشیدی نمیتواند تمامی انرژی طیف خورشید را جذب کند روی محور عمودی قدرت جذب شده تشعشعی و روی محور افقی طول موج

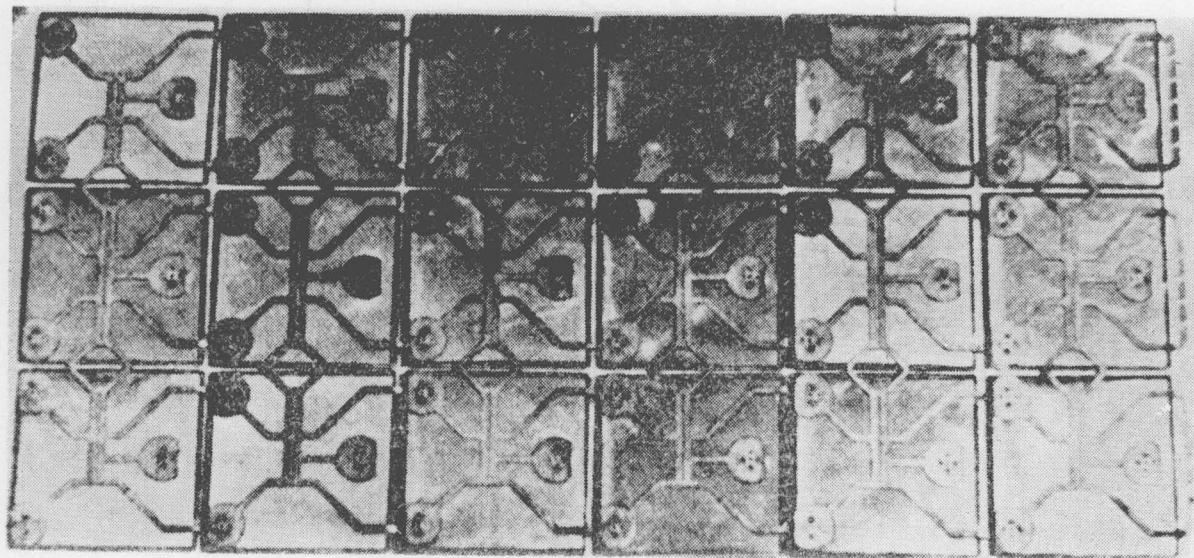
نور برده شده است. اگر تمامی انرژی تشعشعی جذب شود بهره پیل بالا خواهد رفت.



(شکل ۱۰)

شکل شماره ۱۰، ساختمان قسمت پشت عناصر تشکیل دهنده پیل خورشیدای را نشان میدهد.

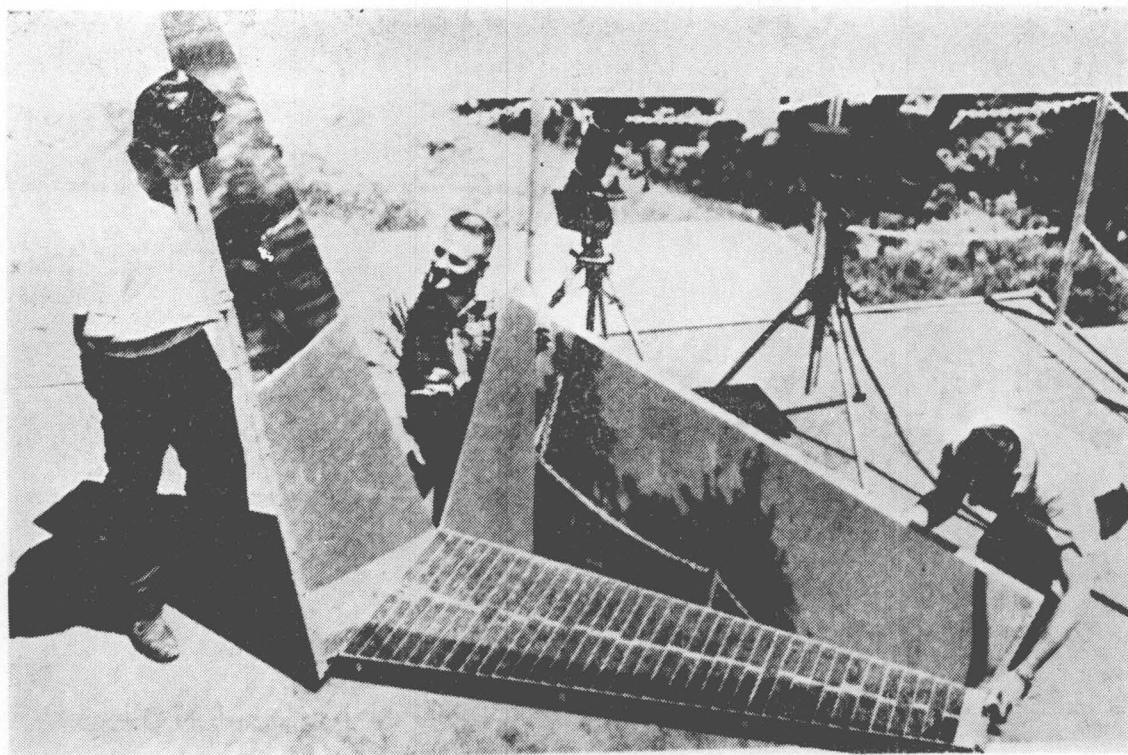
این قسمت مقابله اشعه خورشید قرار نمیگیرد اتصالات مسی الکتریکی برای سری کردن عناصر پیل در شکل پیداست.



(شکل ۱۱)

شکل ۱۲ یک صفحه از پیل های خورشیدی را نشان میدهد از آینه های منعکس کننده جهت بالا

بردن قدرت پیل قبل استفاده میشد که اکنون بعللی متوقف شده است.



(شکل ۱۲)

در شماره بعد راجع به مبدل ترمیانیک بحث خواهد شد.

از منابع زیر در تهیه این مقاله استفاده شده

- 1) J.J. Loferski' Theoretical Consideration Governing The Choice of The Optimum Semiconductor For Photovoltaic Solar Energy Conversion.
Jour. of Appl. Phys. 27 (1965) 777—784.
- 2) P. Rappaport , The Electron Voltaic Effect In P—N Junctions Induced By Beta Particles Bombardmbnt Phys . Rew . VI a3 . January 1954 , D. 246.
- 3) J. Mandelkorn, Improved Non P Silicon Solar Cells , Papero Presented At 19 Th Annual Power Sources Conference. Atlantic City , N. y.1965.
- 4) Mechanical Bngineering Vol. 88. No 10 Oct. 1966.